

Patent Number:

JP60110711

Publication date:

1985-06-17

Inventor(s):

MOMOSE TAKASHI; others: 04

Applicant(s)::

KURORIN ENGINEERS KK

Requested Patent:

☐ JP601<u>10711</u>

Application Number: JP19830218679 19831122

Priority Number(s):

IPC Classification:

C08F291/00; C08F2/54; C08J7/18; H01M2/16

EC Classification:

Equivalents:

#### Abstract

PURPOSE:To facilitate the formation of a graft-polymerized membrane useful as an intermediate for the production of a variety of diaphragms used in electrolysis of salt, fuel cells, etc., by irradiating an inert polymer film with an ionizing radiation and contacting the irradiated film with alpha, beta, betatrifluorostyrene.

CONSTITUTION:An inert polymer film (e.g., polyethylene film or polytetrafluoroethylene film) is irradiated with an ionizing radiation (e.g., electron beams) at a dose of about 1-30Mrad. The obtained film is immersed in a solution of alpha, beta, beta-trifluorostyrene (TFS) or coated with TFS to effect a reaction therebetween at about 10-90 deg.C for about 1-50hr. The obtained graft-polymerized membrane can have desired properties by introducing desired substituents into the benzene ring of TFS as a graft chain, for example, cation exchange membrane by introduction of sulfonic acid groups, anion exchange membrane by introduction of amino groups, and neutral membrane by introduction of hydroxyl groups.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-110711

© Int.Cl.<sup>1</sup>
C 08 F 291/00
2/54
C 08 J 7/18
H 01 M 2/16
// C 08 J 5/22
C 25 B 13/08

識別記号 庁内整理番号 6746-4J

❸公開 昭和60年(1985)6月17日

7446-4F G-6728-5H

7446-4F 6686-4K

4K 審査請求 未請求 発明の数 1 (全 6 頁)

❷発明の名称

グラフト重合膜の製造方法

②特 顧 昭58-218679

之

洋

②出 願 昭58(1983)11月22日

 切発明者
 百
 類

 切発明者
 富家

隆 岡山市 当 男 東京都世

岡山市当新田250-1 当新田マンション105号 東京都世田谷区北沢1-35-11

位 発明者 富家 和位 発明者 原田 博

横浜市戸塚区犬山町28-16

砂発 明 者 宮 地

岡山市妹尾1120-45

⑫発 明 者 加 藤 寛 子

玉野市築港 5 - 15-7

⑪出 願 人 クロリンエンジニアズ

東京都港区虎ノ門2丁目1番1号 商船三井ビル

株式会社

砂代 理 人 弁理士 森 浩之

明細 暫

1. 発明の名称

グラフト重合膜の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) α, β, β-トリフルオロスチレンをグラフト鎖として有する不活性重合体フィルムから成るグラフト膜を製造するに際して、不活性重合体フィルムに電離性放射線を照射し、眩照射フィルムをα, β, β-トリフルオロスチレンまたはその溶液に浸漉または接触させてグラフト重合させるととを特徴とするグラフト重合膜の製造方法。
- (2) 不活性重合体フィルムが、ポリエチレンフィルム、ポリテトラフルオロエチレンフィルム、ポリクロロトリフルオロエチレンフィルム、ポリビニルフレオライドフィルム、ポリビニルフルオライドフィルム、テトラフルオロエチレンープロピレン共重合体フィルム、テトラフルオロエチレンーパーフル

オロアルキルビニルエーテル共重合体フィルム、 クロロトリフルオロエチレンーエチレン共重合体 フィルム、クロロトリフルオロエチレンーブロビ レン共重合体フィルムから成る群から選ばれたフィルムである特許請求の範囲第(1)項に記載の方法。

- (3) 電離性放射線の照射線量が1~30 Mrad である特許請求の範囲第(1)項または第(2)項に記載の製造方法。
- (4) グラフト重合温度が 10~90 ℃ である特許 請求の範囲第(1)項から第(3)項のいずれかに記載の 製造方法。
- (5) グラフト重合時間が 1 ~ 5 0 時間である特 許請求の範囲第(1)項から第(4)項のいずれかに記載 の製造方法。
- (6) α, β, βートリフルオロスチレンの溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、四塩化炭素、1,1,2-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロートリフルオロエタン、ペンセンから成る群から溶媒を使用する特許請求の範囲第(1)項から第(5)項のいずれかに記載の製造方法。

特開昭60~110711(2)

(7) α, β, βートリフルオロスチレンの溶媒を 使用せずにグラフト重合させる特許請求の範囲第 (1) 項から第(5) 項のいずれかに記載の方法。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明は、食塩電解、水電解、燃料電池、亜鉛ーハロゲン型電池、レドックスフロー電池等における各種隔膜として使用可能な、ペンセン環が置換されたα,β,βートリフルオロスチレンを使力として有する膜を製造する際に有用な中間体であるα,β,βートリフルオロスチレンをグラフト類として有する不活性重合体フィルムから成るグラフト項合膜の製造方法に関する。

スルホン化α, β, βートリフルオロスチレン(以下、α, β, βートリフルオロスチレンを「TFS」という)をグラフト鎖として有する不活性重合体フィルムから成る陽イオン交換膜は公知であり(特開昭 5 1 - 8 9 8 8 1 号公報)、該陽イオン交換膜は、食塩電解用、燃料電池用として使用されている。この陽イオン交換膜は、不活性重合体フィルムに、TFSをグラフト重合させた後、グラ

劣るとともに、TFSにも放射線を照射するため、 TFS自体の単独重合、グラフト率の低下、TFS の劣化等が生じるなど、種々の欠点が指摘されて いる。

本発明者らは、上記グラフト重合膜の有用性に 鑑み照射時間が短く、TFSの単独重合や劣化が 生ずることのない経済的な製造を超離性放射 た結果、不活性重合体フィルムのみを電離性放射 彼で照射してラジカルを発生させ、ラジカルを発 生させた該フィルムを、TFSまたはその溶液に 没賃または接触させてグラフト重合させることに より、効率よく上記陽イオン交換膜を製造しりる ことを見い出したのである。

フトしたフィルムをスルホン化して製造されている。

本発明者らは、TFSを不活性重合体フィルムにグラフト重合させた、ペンセン環が置換されていないグラフト膜の用途につき検討した結果、ペンセン環にスルホン酸基のほかにカルボン酸基、又はリン酸基を導入することにより陽イオン交換基として、又、水酸基を導入することにより中性膜としてそれぞれ使用できるとの知見を得た。

不活性重合体フィルムに、TFSをグラフト重合させたグラフト重合膜は従来、不活性重合体フィルムをTFSの不活性有機溶剤溶液に浸潰または接触させ、このフィルムを ®C。等で照射し、TFSをグラフト重合させた後、グラフトしたフィルムをスルホン化して製造されている。しかし、この方法では159程度のグラフト率を有する陽イオン交換膜を製造するためには、照射を約240時間続けなければならず、生産性が低く経済性に

本発明に使用する不活性重合体フィルムは炭化 水器ポリマー、含フッ素炭化水素ポリマー、パー フルオロ炭化水素ポリマー等のいずれから成るも のでもよく、また、ホモポリマーでもコポリマー であってもよく、たとえば、ポリエチレンーポリ テトラフルオロエチレン共重合体フィルム、ポリ クロロトリフルオロエチレンフィルム、ポリビニ リデンフルオライドフィルム、ポリピニルフルオ ライドフィルム、テトラフルオ<sup>†</sup>ロエチレンーヘキ サフルオロプロピレン共重合体フィルム、テトラ フルオロエチレンーエチレン共重合体フィルム、 テトラフルオロエチレンーパーフルオロアルキル ピニルエーテル共重合体フィルム、クロロトリフ ルオロエチレンーエチレン共重合体フィルムから 選ばれる。また、とれらのフィルムは微細な孔を 有するものであってもよい。

との不活性重合体フィルムに照射する放射線は、 該フィルムにラジカルを発生させるものであれば よく、各種の電離性放射線を使用することができ る。照射する電離性放射線量は、不活性重合体フ

特開昭60-110711(3)

ィルムの材質によっても異なるが1~30 Mrad とするのがよい。照射量が1 Mrad以下であると、グラフト重合の進行が不十分であり、30 Mrad を越たると腹機能が低下するので好ましくない。照射は、空気中、酸素雰囲気中、窒素雰囲気中のいずれでも行うととができる。照射したフィルム上に発生したラジカルは、不活性ガス雰囲気中、0 で死約2週間、10で約1週間、室温で2~3日の寿命を有し、放射線照射後、他の場所へ輸送し、後述するグラフト重合を行うことができるので好都合である。

次に、照射したフィルムへのTFSのグラフト 重合を行う。クロロホルム、塩化メチナ、 1,1,2ーテトラクロロエタン、 1,1,2ートリクロロートリフルオロエタン、 ペンゼン等の はに溶解させた TFS、あるいは 溶膜 させる がないない TFSに照射フィルムを 浸漬させる かれて 反応温度を 10~90 C、 反応時間 1~50時間で反応させる。この場合、他に触媒等を加える

塩化メチレン等の混合溶液中にグラフト膜を浸液し、40~150℃で10~100分間反応させ、次いでグラフト膜をIN-KOH水溶液中に入れて90℃で1~2時間処理し、スルホナート型を塩型とする。40~100%のスルホン化率を有し、膜抵抗が0.9~5Ω・αのスルホン酸膜が得られる。

とのよりにして製造した陽イオン交換膜(サンプルとして不活性重合体フィルムがポリエチレンーポリテトラフルオロエチレン共重合体フィルムを使用した)とパーフルオロカーポンスルホン酸型の陽イオン交換膜である Du Pont 社製の Nation(登録商標)120と物性比較を行った。その結果を表1に示す。

表 1

膜	イ ォ ン <sup>(B)</sup> 交換容量	(b) 膜抵抗	伸び率例	(c) 翰率
グラフト重合膜	0.61	1.7 1	3.4 ~ 4.5	0.9 4
Nafion 120	0.8 3	1.48	4.0	0.9 3

- (a) meq/f 乾燥膜 (b) Ωm<sup>1</sup> in 0.5 NKCl
- (c) 0.5 N/1.0 NKC&

必要はなく、単にTFSに浸漬するか接触させる のみで反応が進行し、10~50 多のグラフト率で グラフト重合膜が製造される。

### グラフト率例=<u>グラフト重合膜の重量 - 基材フィルムの重量</u> × 100 基材フィルムの重量

とのグラフト重合膜は、それ自体では特別の用途はないが、ペンゼン環を、スルホン酸基、カルボン酸基又はリン酸基で置換することにより膨イオン交換膜を、アミノ基で置換することにより除イオン交換膜を、水酸基で置換することにより中性膜をそれぞれ製造することができる。 次に、上記のように製造したグラフト重合膜のペンゼン環の置換を、スルホン酸基の導入を例にとって説明する。

スルホン化剤としては、クロルスルホン酸、フルオロスルホン酸、濃硫酸、無水硫酸等を使用することができるが、濃硫酸はスルホン化率が低く、無水硫酸は取扱いが困難なため、クロルスルホン酸又はフルオロスルホン酸を使用することが好ましい。スルホン化剤と四塩化炭素、クロロホルム、

要1から陽イオン交換膜のうち、不活性重合体フィルムが、含フッ素ポリマーから成る膜は、パーフルオロカーボンポリマーから成る膜であるDu Pont社製の Nation 120 とほぼ同様の性能を示すことがわかる。

また、後述する通り陽イオン交換膜は、水電解用、食塩電解用、芒硝電解用、燃料電池用、レドックスフロー電池用、アミノ酸ソーダ電解用、高温電気透析用、亜鉛ーハロゲン型電池用等各種の隔膜として使用することができる。

本発明は、不活性重合体フィルムに電離性放射 線を照射して設フィルムにラジカルを発生させ、 その後、TFSに没演または接触させてグラフト 重合させるようにしてあり、TFSに放射線が照 射されないため、TFSの重合や劣化が生ずることがなく、また放射線照射下で、不活性重合体フィルムにTFSをグラフト重合させるのではないため、放射線照射時間が短くてすみ、放射線の消 役量が少なく、経済的かつ安全な方法である。

以下に本発明の実施例を記載するが、本発明は

特開昭60-110711(4)

とれらの奥施例に限定されるものではない。 奥施例 1

厚さ 100 μの低密度ポリエチレンフィルムに共 振変圧器型電子線加速器を用いて、 2 MV. 1 mAの 照射条件で窒素雰囲気下 1 0 Mrad 照射した。つい でとの照射したポリエチレンフィルムを反応器に 入れて 10 m m H g 被圧下で脱気後、あらかじめ凍 結脱気法により溶存酸素を除去したα,β,βート リフルオロスチレンを反応器に注入して、 照射し たポリエチレンフィルムがα,β,βートリフルオ ロスチレン中に役債した状態で、 室温下、 2 0 時 間反応せしめた。反応後、容器からグラフトされ たフィルムを取出し、 n ー へ キサンで洗浄後、 乾 像した。 とうして得られたグラフト重合膜のグラ フト率は 2 3 男であった。

このグラフト重合膜をクロルスルホン酸 3 0 部、四塩化炭素 7 0 部からなる溶液中に 4 0 ℃ で 4 0 分間浸資処理 し、スルホン化せ しめた。 反応後、容器からグラフト膜を取出し、四塩化炭素で洗浄して余剰のクロルスルホン酸を除いた。得られた

NKCe/1.0NKCeで測定した輪率は0.93であった。 またグラフト重合膜をモール塩4ppmを含む3% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>水溶液に70℃で24時間浸漬処理したとこ ろ、グラフト重合膜の重量減少率は10%であった。

#### 実施例3

スルホン化されたグラフト重合膜のスルホン化率は95%であった。

この膜を 1 NKOH 溶液中に 9 0 ℃ で 2 時間浸漬処理し、加水分解せしめた。 このようにして得られたグラフト 重合膜のイオン交換容量は 1.5 meq/9 一乾燥膜であった。

このグラフト重合膜を 0.6 NKCl中 2 0 ℃、1 KHz の交流で測定した電気抵抗は 1.4 Ω・cd であり、0.5 NKCl/1.0 NKCl で測定した輪率は 0.9 0 であった。また、グラフト重合膜をモール塩 4 ppm を含む 3 罗 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 水溶液に 7 0 ℃ で 2 4 時間浸渡処理したところ、フィルムの重量減少率は 1 5 多であった。実施例 2

厚さ 100 μのポリビニリデンフルオライドフィルムを用いた以外は、実施例 1 と全く同じ方法でグラフト 重合膜を得た。このときのグラフト率は20%、スルホン化率は60%であり、イオン交換容量は0.6 meg/8 - 乾燥膜であった。

このグラフト重合膜を 0.6 N KCℓ中 2 0 ℃、1 KHz の交流で測定した電気抵抗は 3.2 Ω • cd であり、0.5

た。

第1図は、TFSをグラフト重合する前のテトラフルオロエチレンーエチレン共重合体フィルムの表面赤外吸収スペクトル、第2図は、眩フィルムにTFSをグラフト重合させたグラフト重合膜の表面赤外吸収スペクトルである。

第2図中、1720及び1640cm つの吸収は、ペンセン環の二重結合を、690cm つの吸収はペンセン環の一置換をそれぞれ示すものであり、両スペクトルからTFSがテトラフルオロエチレンーエチレン共重合体フィルムにグラフト重合していることを確認した。

とのグラフト重合膜をクロルスルホン酸 3 0 部、1,1,2,2ーテトラクロロエタンからなる溶液中に 135 C で 4 0 分間浸漬処理し、スルホン化せしめた。反応後、容器からグラフト重合膜を取出し、四塩化炭素で洗浄して余剰のクロルスルホン酸を除いた。とうして得たグラフト重合膜のスルホン化率は 9 0 % であった。

とのグラフト重合膜を1NKOH溶液中に90℃

特開昭60-110711(5)

このグラフト重合膜を 0.6 NKCl 中 2 0 ℃、1 KHz の交流で測定した電気抵抗は 2.1 Ω · cd であり、0.5 NKCl/1.0 NKCl で測定した 物率は 0.9 2 であった。また、このフィルムをモール塩 4 ppm を含む 3 % HaO\*水溶液に 7 0 ℃ で 2 4 時間浸液処理したところ、フィルムの重量減少率は 3 % であった。実施例 4

厚さ 100 μのテトラフルオロエチレンーエチレン共重合体フィルムに実施例 3 と全く同じ方法でグラフト重合及びスルホン化を行いグラフト重合膜を得た。 このときのグラフト率は 1 6 %、スルホン化率は 8 0 % であり、 0.7 meq/8 - 乾燥膜 であった。

1 対 1 で混合し、この混合粉末をポリテトラフルオロエチレンを結合材として、350で、126 kg/cml、3 0 分間圧着した。次に、別に黒鉛とポリテトラフルオロエチレンのエマルジョンを重量比 8 対 2 で混合し、この混合物を350で、130 kg/cml、3 0 分間ホットプレスして100 μの厚さを有する多孔性膜とした。この多孔性膜を、触媒層を有するグラフト膜の片面に350で、130 kg/cml で3 0 分間加熱保持して付着させ、この多孔性膜面を酸紫極側とする燃料電池とした。

#### 爽施例7

東施例4の方法に従って合成されたグラフト重合膜を用いて有効通電面積1dm。の電解槽によって飽和食塩水を電気分解した。陽極にはチタンメッシュにTiOx,RuOxをコーティングしたものを用い、陰極にはステンレス製のメッシュを用いた。陽極室に飽和食塩水を供給し電流密度30A/dm。で電解したところ、電流効率92%、セル電圧は3.3 Vで30%NaOHを取得した。

3 乡 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>水溶液に 7 0 ℃ で 2 4 時間浸液処理した ところ、グラフト重合膜の重量減少率は 3 多であった。

#### 実施例 5

厚さ 100 μのポリテトラフルオロエチレンフィルムに契施例 3 と全く同じ方法でグラフト重合及びスルホン化を行いグラフト重合膜を得た。 このときのグラフト率は 1 8 %、スルホン化率は 6 0 %であり、イオン交換容量は 0.6 meq/8 - 乾燥膜であった。

とのグラフト重合膜を  $0.6\,\mathrm{N}\,\mathrm{KCl}$ 中  $2\,\mathrm{0}\,\mathrm{C}$ 、 $1\,\mathrm{KHz}$ の交流で測定した電気抵抗は  $4.0\,\Omega$  · cal であり、  $0.5\,\mathrm{N}\,\mathrm{KCl}$  /  $1.0\,\mathrm{N}\,\mathrm{KCl}$  で測定した輪率は  $0.9\,3$  であった。またとのグラフト重合膜をモール塩  $4\,\mathrm{ppm}$  を含む  $3\,\mathrm{9}\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}_2$  水溶液に  $7\,\mathrm{0}\,\mathrm{c}\,\mathrm{c}\,\mathrm{2}\,4\,\mathrm{e}\,\mathrm{ll}$  浸渍処理したところ、グラフト重合膜の重量減少率は  $1\,\mathrm{9}\,\mathrm{U}\,\mathrm{r}$ であった。

### 奥施例 6

実施例 4 の方法に従って合成されたグラフト重合膜の両面にルテニウム県と規鉛粉末を重量比で

## 实施例8

実施例4の方法に従って合成されたグラフト重合膜2枚によって陽極室、中央区分室、陰極室に区画した三室電解槽とし、陽極にチタンメッシュにTiOx, RuOxをコーティングしたものを、陰極にはNiメッシュを用い、陽極室に10%HaSOx、中央区分室に15%Na2SOx、陰極室に10%NaOHをそれぞれ供給して電流密度20A/dmaで電解したところ、中央区分室から4%HaSOx落液、陰極室から15%NaOHを、電流効率70%、セル電圧4.2 Vで取得した。

代理人 弁理士 森 佑 之

## 手統補正書(自発)

昭和59年3月/5日

特許庁長官 若杉和夫殿

1. 事件の表示

昭和58年特許願第218679号

2. 発明の名称

グラフト重合膜の製造方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人 住 所 東京都港区成ノ門二丁目1番1号 商鉛三井ビル

名 称 クロリンエンジニアズ株式会社 代表者 佐 藤 純 二

4. 代 理 人 (〒105)

住 所 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号 商船三井ビル

クロリンエンジニアズ株式会社内

氏 名 弁理士(8672)森 浩 之 電話:03-587-1771

5. 拒絶理由通知の日付

自発

6. 補正の対象

明細書の「図面の簡単な説明」の概及び図面

# 特開昭60-110711(6)

### 7. 補正の内容

(1) 明細書第18頁第11行「で取得した。」 の次に改行して、

# 「4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施例3における、 TFSをグラフト重合する前のテトラフ ルオロエチレンーエチレン共重合体フィ ルムの表面赤外吸収スペクトル、第2図 は、該フィルムにTFSをグラフト重合 させたグラフト重合膜の装面赤外吸収スペクトルである。」

を加入する。

(2) 別忝の通り、第1図及び第2図を加入する。

(以 上)

